

# DOW BCB4026-46 负性光敏光刻胶 抗腐蚀涂层材料

产品名称	DOW BCB4026-46 负性光敏光刻胶 抗腐蚀涂层材料
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10 190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

## 产品详情

4026-46

4026-46

小包装量

1

是否现货

是

加工定制

是

功能

高深宽比，耐刻蚀，耐高温，化学稳定性强

厚度范围

0.1~200UM

单位

ml

优点

高深宽比，垂直性好

型号

BCB4000系列

类型

半导体材料

包装

瓶装

售卖地区

全国

品质保障

质量过硬

数量

999

产品类型

半导体材料

运输方式

汽运物流

PMMA(polymethyl methacrylate)是一种非常适合许多成像和非成像微电子应用程序的聚合物材料。通常用于电子束工艺曝光，如T-gate制造。还用于临时晶片接合工艺如晶片减薄，用作保护层和临时粘合剂。

PMMA光刻胶是PMMA聚合物被溶解在特定的分子量溶剂中，如苯甲醚（安全的溶剂），然后过滤。传统曝光，直接写曝光或X-射线曝光使聚合物的断链，从而在光刻胶的曝光和未曝光区域之间产生溶解度差异，实现非常高分辨率的图像。

PMMA的分类：

1) PMMA 495 A系列

2) PMMA 495 C系列

3) PMMA 950 A系列

4) PMMA 950 C系列

PMMA特性：

1) 溶剂：苯甲醚（A）和氯苯（C）

2) 非常适合于电子束光刻和X射线曝光

3) 高分辨率： $<0.1\mu\text{m}$ ，PMMA 950适用于高分辨率的应用，PMMA 495则相对较低

4) 广范围分子量和粘度

应用：电子束光刻、多层T-Gate剥离、晶圆减薄等。

相关溶液：

1) 显影液：MIBK:IPA

2) 去胶剂：Remover PG

3) 稀释剂：A Thinner